

# 機能性酸化物探索の新展開

～more oxide, beyond oxide～

3月20日(日) 13:15～ H111会場

## 招待講演 (敬称略)

- 藤田 静雄 (京都大学)

「酸化物薄膜の成膜に向けたミストCVD技術の進展」

- 高橋 圭 (理化学研究所)

「ガスソースMBE高品質酸化物薄膜で拓く酸化物エレクトロニクス」

- 生田 博志 (名古屋大学)

「鉄系超伝導体の薄膜成長」

- 近松 彰 (東京大学)

「トポクティック反応を用いた複合アニオン酸化物エピタキシー」

- 大場 史康 (東京工業大学)

「半導体の物性予測と物質探索 - 先端計算科学からのアプローチ」



企画：機能性酸化物研究グループ、 後援：薄膜・表面物理分科会

世話人：廣瀬靖(東大), 神吉輝夫(阪大), 組頭広志(KEK), 田中秀和(阪大), 秋永広幸(産総研)